

# C在不同位置掺杂( $n, n$ )型BN纳米管的 密度泛函研究\*

王艳丽<sup>†</sup> 苏克和 颜红侠 王欣

(西北工业大学理学院应用化学系, 空间应用物理与化学教育部重点实验室, 西安 710072)

(2013年9月8日收到; 2013年11月1日收到修改稿)

用密度泛函 B3LYP/3-21G(d) 方法, 并利用周期边界条件, 研究了 C 原子在不同位置掺杂的 ( $n, n$ ) 型 BN 纳米管的结构与性质. 揭示了几何结构特征、能量、稳定性和能带结构的变化规律. 研究了 C 原子在 B 位或 N 位置分别掺杂的 BN 纳米管的模型 (掺杂浓度  $x = 1/(4n)$ ,  $n = 3-9$ ), 部分 B 位掺杂管发生了变形, 而所有 N 位掺杂管则几乎不变形, 而且 N 位比 B 位的掺杂能更低 (管更稳定), B 位掺杂管的能隙为 1.054—2.411 eV, N 掺杂管的能隙为 0.252—1.207 eV, 所有掺杂管都是半导体, 所有掺杂管都具有直接带隙.

**关键词:** 掺杂, 碳纳米管, 周期边界条件, 能带结构

**PACS:** 61.46.Np, 81.07.De

**DOI:** 10.7498/aps.63.046101

## 1 引言

硼碳氮 (B-C-N)<sup>[1]</sup> 层状材料可认为是石墨和 BN 的混合物. 与石墨相仿, B-C-N 层状材料也可生成纳米管, 这类纳米管也可认为是碳纳米管 (CNT) 与 BN 纳米管 (BN-NT) 的混合物. 事实上, 实验已经证实了 B-C-N 纳米管的存在<sup>[2]</sup>. 理论和实验已证实 BC<sub>2</sub>N 纳米管具有半导体性质<sup>[3]</sup>, 能隙为 2 eV, BC<sub>2</sub>N 纳米管还可成为有效的蓝光和紫外光发射器<sup>[4,5]</sup>. 文献<sup>[6, 7]</sup>研究了 BC<sub>2</sub>N 体系倾向于分裂为纯的 C 和 BN 区域的 B-C-N 体系.

Azevedo<sup>[8]</sup>研究了 C 在不同的位置掺杂的 BN-NT, 表明掺杂管的电子结构与形变结构无关, 而与 C 原子的掺杂方式有关. 文献<sup>[9]</sup>研究 C 原子掺杂的 (10, 0) 型 BN 纳米管得出, 体系中若没有 C—C 键, 就会产生自旋极化, 掺杂体系可能会有微弱的磁性. C 掺杂的 (9, 0) BN 纳米管, 发现 H 原子更易于吸附在 C 位上, 而在纯的 BN 纳

米管上, H 更易吸附在 B 原子上<sup>[10]</sup>. Mirzaei<sup>[11]</sup>计算所得的 C 在不同位置掺杂所得 (4, 4)BN 纳米管的 N 位掺杂的核磁共振 (NMR) 特征变化较大, 而 B 位掺杂几乎没什么变化. 文献<sup>[12]</sup>利用 C 原子簇模型研究了 C 分别在 B 位和 N 位掺杂的 BN 纳米管, 得出 C 在 B 位掺杂的模型为宽带隙半导体, 而在 N 位掺杂的模型为窄带隙半导体.

本小组研究的 ( $n, n$ ) 型 CNT, BN-NT 以及一些 B-C-N 纳米管表明<sup>[13-15]</sup>, 纳米管的导电性随着  $n$  呈现出一定规律, 并发现在 B-C-N 纳米管最稳定结构的特征是碳纳米管中掺杂了平行于管轴的 -B-N-B-N-直链, 这种管具有典型的半导体特征<sup>[15]</sup>. 而在 BN 纳米管中, C 原子于 -B-N-B-N-直链上分别在 B 位或 N 位上取代的模型, 其结构和性能还是未知的, 尤其是随管径的变化规律未见报道. 本文研究 C 原子在 B 或 N 位掺杂 ( $n, n$ ) BN 纳米管 ( $n = 3-9$ ) 模型的几何结构、掺杂能量和能带结构特征.

\* 国家自然科学基金 (批准号: 50572089) 和西北工业大学基础基金 (批准号: JC201269) 资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯作者. E-mail: wangyanli@nwpu.edu.cn

## 2 计算方法与模型

本文用密度泛函 B3LYP 方法和 3-21G\* 基组, 并利用周期边界条件 (PBC) 模拟两端开口的纳米管超长结构<sup>[16]</sup>, 研究了 C 原子分别在不同的位置 (即在 B 位或 N 位) 替换掺杂 ( $n, n$ ) BN 纳米管 ( $n = 3-9$ ) 的结构. 研究中选取一个原胞中的 1 个

原子被取代的模型; 为保持重复单元的电中性, 选取 2 个原胞为模型的最小重复单元.

## 3 结果与讨论

### 3.1 结构变形与参数

C 原子在 B 或 N 位掺杂 ( $n, n$ ) BN 纳米管 ( $n = 3-9$ ), 掺杂浓度为一个原胞中掺杂一个 C 原子, 即

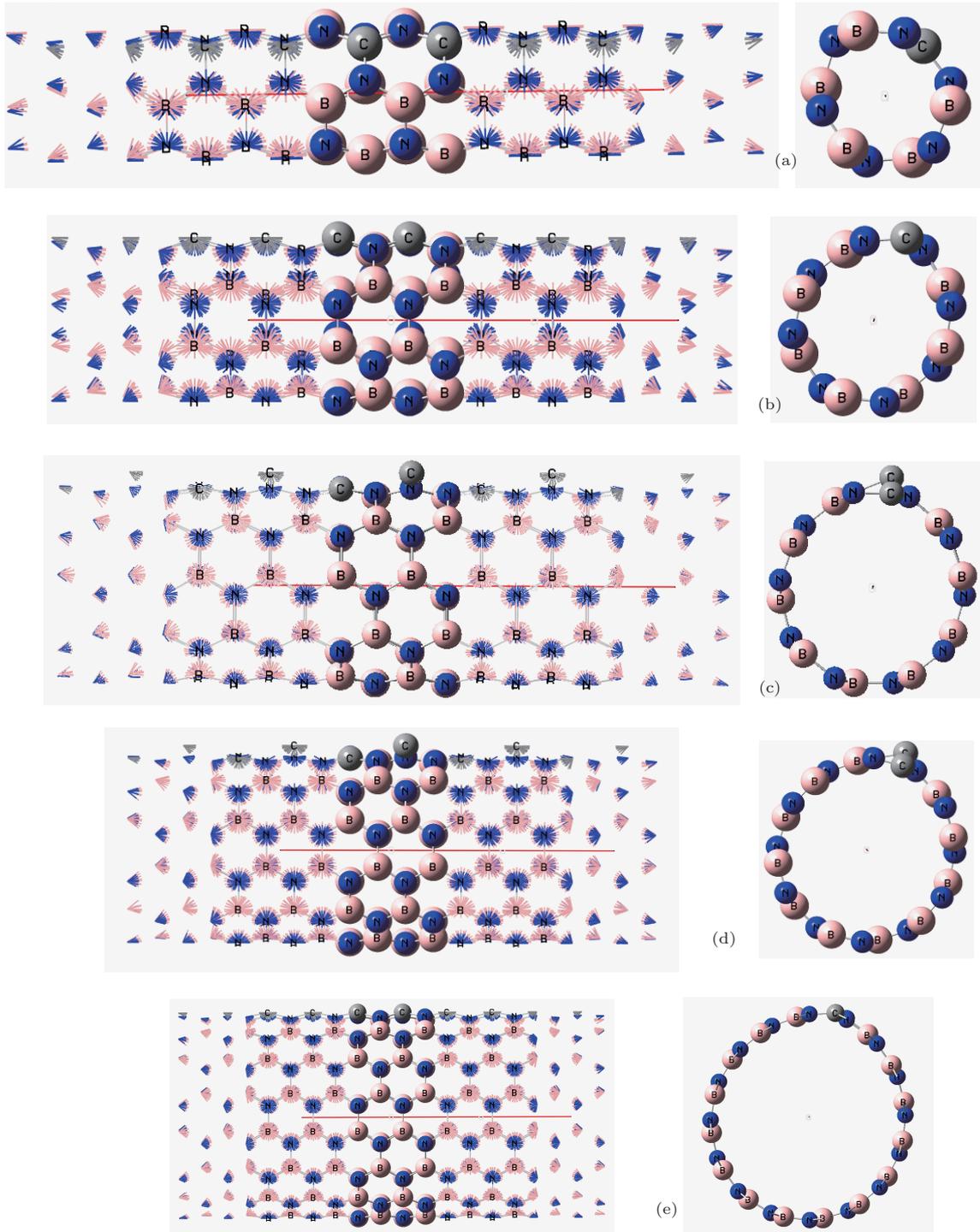


图1 C原子在B位掺杂扶手椅型 ( $n, n$ ) BN 纳米管的管状和横截面结构 (a) (3, 3) 管; (b) (4, 4) 管; (c) (5, 5) 管; (d) (6, 6) 管; (e) (8, 8) 管; 实心原子表示一个原胞中的原子

掺杂比例为  $x = 1/(4n)$ ; 采用两个原胞作为一个模型的重复单元. C原子在B原子位置替换掺杂( $n, n$ ) BN纳米管的结构如图1所示, 结构参数如表1所列.

表1数据表明, 平键键长  $L_1(X-C)$  ( $X$ 代表B或N原子, 下标1表示键与轴垂直)总是比斜键键长  $L_2(X-C)$  (下标2表示键和轴不垂直, 与轴倾斜)要长. 有些模型中的两个原胞中, 掺杂C原子的平键键长  $L_1(X-C)$  或斜键键长  $L_2(X-C)$  并不相等, 故分别表示为  $L_1(X-C_1)$  和  $L_1(X-C_2)$  或

$L_2(X-C_1)$  和  $L_2(X-C_2)$ ; 因此这些模型中, 掺杂C原子的两管的管径也不同, 以  $D_1$  和  $D_2$  分别代表掺杂C原子较大和较小的管径. 当  $n = 3, 5, 6$  时, 因两原胞中的N—C键的两个  $L_1$  键长不相等, 两个  $L_2$  键长也不相等, 则B位掺杂 ( $C_B$ -doped) 的BN纳米管的  $D_1/D_2$  为1.118, 1.077 和1.067; 而当  $n = 4$  时和  $n = 7-9$  时,  $C_B$ -doped 纳米管的  $D_1/D_2 = 1$ , 两管径并无差别. 而所有N位掺杂 ( $C_N$ -doped) 的BN纳米管, 两个原胞中的同类B—C键键长几乎没差别, 两管径也相等, 即  $D_1/D_2 = 1$ .

表1 用PBC-B3LYP/3-21G(d)方法优化的( $n, n$ )型C在B位和N位掺杂的BN纳米管的结构参数( $X = B, N$ , 参数下标的数字表示原子的序号, 对应于图1上的原子标号)

掺杂位置	$n$	$D(X-C_1)$	$D(X-C_2)$	$D_1/D_2$	$L_1(X-C_1)$	$L_1(X-C_2)$	$L_2(X-C_1)$	$L_2(X-C_2)$	$\bar{a}$	Mülliken	Mülliken
		/nm	/nm		/nm	/nm	/nm	/nm	/nm	(C <sub>1</sub> )	(C <sub>2</sub> )
B	3	0.4842	0.4330	1.118	0.1402	0.1587	0.1390	0.1638	0.5052	0.698	0.272
B	4	0.6030	0.6031	1.000	0.1473	0.1473	0.1438	0.1473	0.5039	0.553	0.553
B	5	0.7188	0.7747	1.077	0.1402	0.1541	0.1382	0.1628	0.5050	0.766	0.281
B	6	0.9227	0.8645	1.067	0.1401	0.1533	0.1381	0.1624	0.5051	0.775	0.281
B	7	1.0394	1.0394	1.000	0.1456	0.1456	0.1430	0.1466	0.5047	0.586	0.586
B	8	1.1845	1.1844	1.000	0.1453	0.1453	0.1465	0.1429	0.5048	0.592	0.592
B	9	1.3150	1.3150	1.000	0.1450	0.1450	0.1444	0.1444	0.5050	0.601	0.601
N	3	0.4321	0.4321	1.000	0.1577	0.1577	0.1493	0.1537	0.5118	-0.818	-0.818
N	4	0.5836	0.5837	1.000	0.1581	0.1581	0.1501	0.1501	0.5107	-0.833	-0.833
N	5	0.7187	0.7186	1.000	0.1570	0.1571	0.1493	0.1533	0.5089	-0.857	-0.857
N	6	0.8655	0.8655	1.000	0.1577	0.1577	0.1499	0.1499	0.5090	-0.865	-0.865
N	7	1.0004	1.0004	1.000	0.1575	0.1576	0.1491	0.1508	0.5085	-0.876	-0.876
N	8	1.1451	1.1468	1.000	0.1577	0.1573	0.1500	0.1496	0.5082	-0.880	-0.889
N	9	1.2683	1.2683	1.000	0.1574	0.1574	0.1498	0.1498	0.5080	-0.892	-0.892

原子的Mülliken电荷也列入表1中. 由表1可见, 在BN-NT及其C掺杂管中, Mülliken (B)总是为正值, 而Mülliken (N)总是为负值; C在B位掺杂的模型中, C与3个N原子相连, Mülliken (C)原子的原子电荷为正值; 而C在N位掺杂的模型中, Mülliken (C)为负值, 与B, C和N原子的电负性2.04, 2.55和3.04相一致 (Pauling scale)<sup>[17]</sup>. 当  $n = 3, 5, 6$  时, 两个原胞中的C原子的Mülliken值并不相同, 这与两原胞的结构变形(结构参数)不同是一致的, 其他模型中两个C原子的Mülliken值相同, 并随着  $n$  的增大而增大. 所有C原子的N位掺

杂管, 两个原子的Mülliken电荷值都相同, 并随着  $n$  的增大, Mülliken (C)的绝对值增大. 可以看出, 两个原胞中的C原子的Mülliken值是否相同是与模型的结构变形是否一致相统一的.

### 3.2 能量和掺杂能

C原子于B位或N位掺杂BN-NT的B-C-N纳米管模型, 稳定性可用掺杂能量( $\Delta E_d$ )来衡量. 定义掺杂能量( $\Delta E_d$ )为一个单元模型的每个原子在掺杂前后能量变化的平均值:

$$\Delta E_d = [E_{d,B-C-NNT} - E_{CNT}]$$

$$+ (n_{\text{atom}} - y)E_{C \text{ atom}} - (xE_{B \text{ atom}} + zE_{N \text{ atom}})]/n_{\text{atom}}, \quad (1)$$

(1) 式中  $E_{d,B-C-N \text{ NT}}$  和  $E_{CNT}$  分别代表三元体系 B-C-N 纳米管和未掺杂 CNT 单元模型的能量;  $E_{B \text{ atom}}$  和  $E_{N \text{ atom}}$  和  $E_{C \text{ atom}}$  分别代表 B, N 和 C 原子的能量,  $n_{\text{atom}}$  表示原胞中所含原子数目. 在本文中, 一个单元模型包含了两个原胞, 掺杂能量 ( $\Delta E_d$ ) 与  $n$  的关系如图 2 所示, 数据列于表 2 中.

从图 2 可以看出, 对于相同的  $n$ , B 位掺杂模型的掺杂能量  $\Delta E_d$  比 N 位掺杂要大, 说明 N 位掺杂构型更稳定, 掺杂也更容易. 当  $n$  较小时, B 位与 N 位掺杂管的  $\Delta E_d$  相差较大, 如  $n = 3, 4$  时, 两者相差分别为 0.158 和 0.124 eV·atom<sup>-1</sup>; 随着  $n$  的增大, 两者的相差值减小. 当  $n = 9$  时, 两值相差减小为 0.056 eV·atom<sup>-1</sup>.

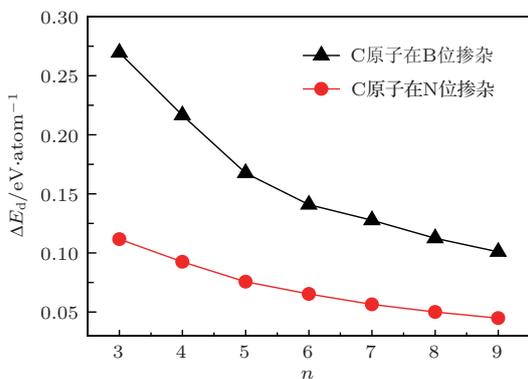


图2 PBC-B3LYP/3-21G(d) 方法计算的 C 原子取代 B 位或 N 位的 B-N-C 纳米管的掺杂能  $\Delta E_d$  与  $n$  的关系

表2 C 原子取代 B 位或 N 位的 B<sub>x</sub>N<sub>y</sub>C<sub>z</sub> 纳米管的掺杂能量 [(1) 式]

NT 模型 (n, n)	$\Delta E_d$ [C <sub>B-doped</sub> ] /eV·atom <sup>-1</sup>	$\Delta E_d$ [C <sub>N-doped</sub> ] /eV·atom <sup>-1</sup>
(3, 3)	0.270	0.112
(4, 4)	0.216	0.092
(5, 5)	0.168	0.076
(6, 6)	0.141	0.065
(7, 7)	0.127	0.056
(8, 8)	0.112	0.050
(9, 9)	0.101	0.045

### 3.3 能带结构特征

C 原子在 B 位或 N 位掺杂的 BN 纳米管的一维能带结构如图 3 所示 (当  $n = 7-9$  时, 能带结构相仿, 因此只例举了  $n = 3-6, 8$  能带图). 图中绘出

了 5 条最高占据轨道 (实线) 和 5 条最低非占据轨道 (虚线) 的能带, 对应的能隙如表 3 所列.

结果表明, 当  $n$  较大时, 能带结构有不程度的兼并. C 原子无论在 B 位还是在 N 位的掺杂模型 ( $n = 3-9$ ), 能隙的类型都是直接带隙, 即两端未封口超长纳米管的一维晶体模型, 其能带结构的晶体最高占据轨道 (HOCO) 导带低与晶体最低非占据轨道 (LUCO) 价带顶对应同一个  $k$  点, 且这一点都对应于图中的 X 点. 对于相同的  $n$ , 所有 B 位掺杂 (C<sub>B-doped</sub>) 的能隙比 N 位 (C<sub>N-doped</sub>) 大. 当  $n = 3, 5, 6$  时, B 位掺杂管为宽带隙半导体, 能隙分别为 2.411, 2.345 和 2.305 eV, 是宽带隙半导体; 其他的  $n = 3-8$  的 B 位掺杂管能隙值在 0.937—1.054 eV 之间, 为典型的半导体. 这个结果与当  $n = 3, 5, 6$  时所得 C 原子的 Mulliken (C) 原子电荷不同于其他模型是一致的. 当  $n = 3-8$  时, 所有 N 位掺杂管 (C<sub>N-doped</sub>) 都是典型的半导体, 能隙值在 0.171—1.207 eV. 当  $n = 9$  时, B 位和 N 位掺杂管都是金属管, 两值相近, 为 0.057 eV. 而  $n = 7-9$  的 B 位掺杂管和 N 位掺杂管都为典型半导体, 对于相同的  $n$ , 所有 B 位掺杂管的能隙比 N 位掺杂大, 所得结论与文献 [12] 相似, 即 B 位掺杂的模型比 N 位掺杂的带隙宽.

有趣的是, B 位掺杂的  $n = 3$  的管的能隙值比  $n = 4$  的管明显大, 高出 1.3 eV,  $n = 5, 7$  的管的能隙值分别比  $n = 6, 8$  稍大, 能隙值体现出与  $n$  的奇偶有关的特征, 而 B 位掺杂管这一特征更加明显,  $n = 3, 5, 7$  的管的能隙值分别比  $n = 4, 6, 8$  的管高出 1.0, 0.8, 0.4 eV, 能隙值体现出与  $n$  的奇偶明显相关的特征. 这与几何结构变化的规律一致, 是掺杂原子改变了 C 原子的电子散射中心的变化特征所致.

## 4 结 论

本文用 B3LYP/3-21G(d) 密度泛函方法, 并利用周期边界条件, 研究了 C 在不同位置掺杂的 ( $n, n$ ) 型 BN 纳米管 (掺杂比例  $x$  为 1/20) 的几何结构、掺杂能量和能带结构. 主要结论如下:

- 1) 当  $n = 3, 5, 6$  时, B 位掺杂 BN 纳米管的两原胞中的结构参数如 N—C 键长并不相等; 而当  $n = 4$  和  $n = 7-9$  时, B 位掺杂管的结构参数并无

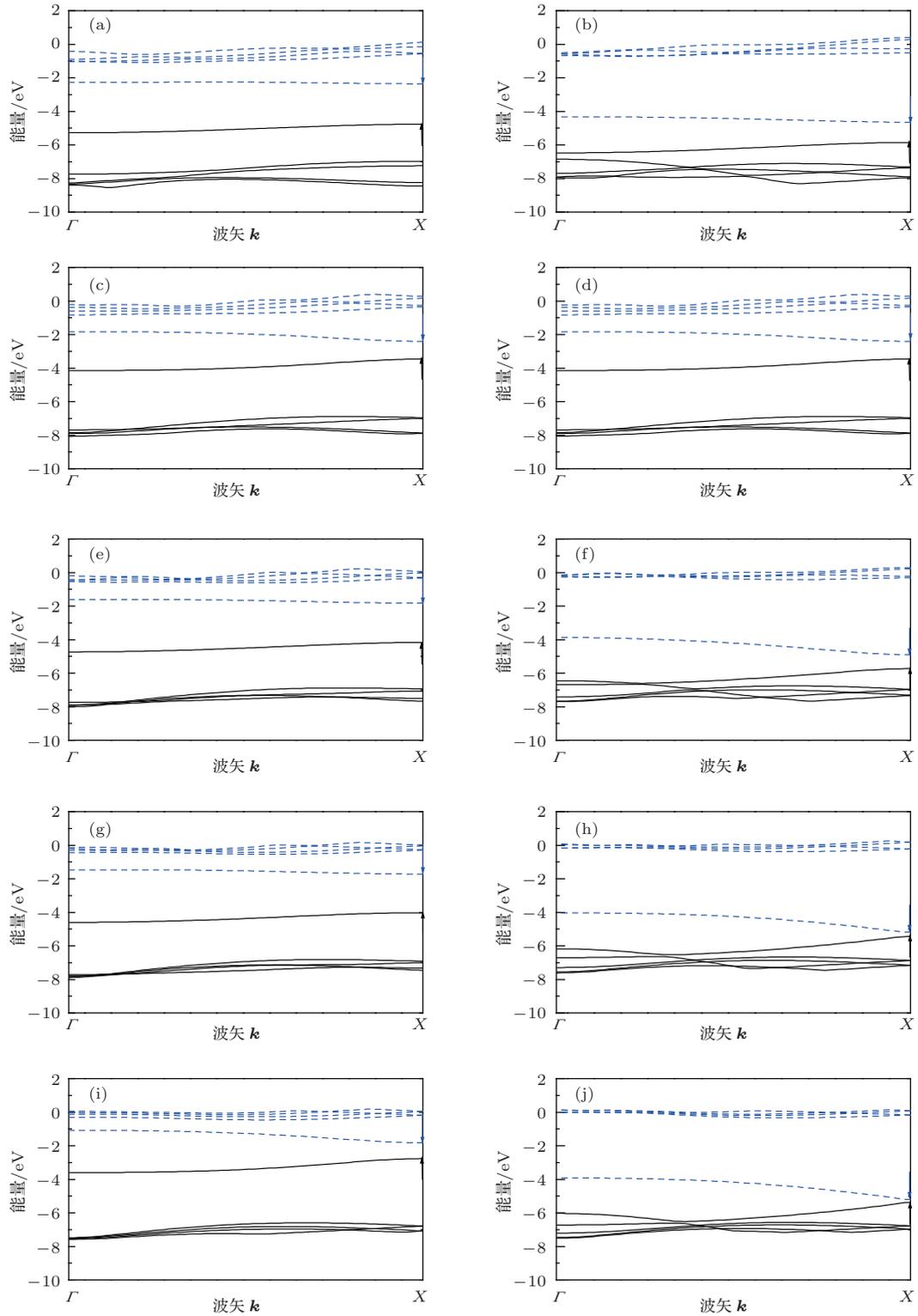


图3 C在B或N位掺杂的 $(n, n)$  BN-NT模型的能带结构[PBC-B3LYP/3-21G(d)]实线为满带,虚线为空带,各绘制5条, $k$ 点为波矢 $k$ 的取值数; LUMO的最大值、HOMO的最小值和能隙 $E_g$ 用箭头标出 (a)  $C_B$ -doped (3, 3) BN-NT; (b)  $C_N$ -doped (3, 3) BN-NT; (c)  $C_B$ -doped (4, 4) BN-NT; (d)  $C_N$ -doped (4, 4) BN-NT; (e)  $C_B$ -doped (5, 5) BN-NT; (f)  $C_N$ -doped (5, 5) BN-NT; (g)  $C_B$ -doped (6, 6) BN-NT; (h)  $C_N$ -doped (6, 6) BN-NT; (i)  $C_B$ -doped (8, 8) BN-NT; (j)  $C_N$ -doped (8, 8) BN-NT

表3 C在B或N位掺杂的(n, n) BN-NT的HOCO或LUCO能量、能隙( $E_g = E_{LUCO} - E_{HOCO}$ )以及能隙的类型 [PBC-B3LYP /3-21G(d) 方法]

NT 模型 (n, n)	$C_{B-doped}$				$C_{N-doped}$			
	$E_{HOCO}/eV$	$E_{LUCO}/eV$	$E_g/eV$	能隙类型	$E_{HOCO}/eV$	$E_{LUCO}/eV$	$E_g/eV$	能隙类型
(3, 3)	-4.767	-2.356	2.411	直接	-5.854	-4.647	1.207	直接
(4, 4)	-3.461	-2.407	1.054	直接	-5.440	-5.156	0.283	直接
(5, 5)	-4.170	-1.825	2.345	直接	-5.732	-4.904	0.828	直接
(6, 6)	-4.023	-1.718	2.305	直接	-5.435	-5.183	0.252	直接
(7, 7)	-2.869	-1.916	0.953	直接	-5.548	-5.054	0.494	直接
(8, 8)	-2.765	-1.828	0.937	直接	-5.377	-5.206	0.171	直接
(9, 9)	-2.217	-2.160	0.057	直接	-5.316	-5.258	0.057	直接

差别, 而所有N位掺杂管中, 两个原胞中的结构参数相同;

2) 对于相同的n, B位掺杂的BN纳米管的掺杂能量比N位掺杂的要大2倍多, 说明N位掺杂的构型稳定, 掺杂也更容易;

3) 当n = 3—6时, B位和N位掺杂的BN纳米管为直接带隙, 而n = 7—9的大管为直接带隙; 当n = 3, 5, 6时, B位掺杂管为宽带隙半导体, 能隙分别为2.411, 2.345和2.305 eV, 而n = 7—9的B位掺杂管和所有的N位掺杂管都为典型半导体; 对于相同的n, 所有B位掺杂管的能隙比N位掺杂大.

参考文献

[1] Yoshiyuki M, Angel R, Marvin L C, Steven G L 1994 *Phys. Rev. B* **50** 4976  
 [2] Blase X, Charlier J C, Vita A D, Car R 1997 *Phys. Lett.* **70** 197  
 [3] Chen Y, Barnard J C, Palmer R E, Watanabe M O, Sasaki T 1999 *Phys. Rev. Lett.* **83** 2406  
 [4] Bai X D, Guo J D, Yu J, Wang E G, Yuan J, Zhou W Z 2000 *Appl. Phys. Lett.* **76** 2624  
 [5] Bai X D, Wang E G, Yu J, Yang H 2000 *Appl. Phys. Lett.* **77** 67

[6] Terrones M, Benito A M, Manteca-Diego C, Hsu W K, Osman O I, Hare J P, Reid D G, Terrones H, Cheetham A K, Prassides K, Kroto H W, Walton D R M 1996 *Chem. Phys. Lett.* **257** 576  
 [7] Louchev O A, Sato Y, Kanda H, Bando Y 2000 *Appl. Phys. Lett.* **77** 1446  
 [8] Azevedo S, Rosas A, Machado M, Kaschny J R, Chacham H 2013 *J. Solid State Chem.* **197** 254  
 [9] Li F, Xia Y Y, Zhao M W, Liu X D, Huang B, Ji Y J, Song C 2006 *Phys. Lett. A* **357** 369  
 [10] Guo C S, Fan W J, Zhang R Q 2006 *Solid State Commun.* **137** 246  
 [11] Mahmoud M 2009 *Physica E* **41** 883  
 [12] Zhao J X, Dai B Q 2004 *Mater. Chem. Phys.* **88** 244  
 [13] Wang Y L, Su K H, Wang X, Liu Y 2011 *Acta Phys. Sin.* **60** 098111 (in Chinese)[王艳丽, 苏克和, 王欣, 刘艳 2011 物理学报 **60** 098111]  
 [14] Wang Y L, Zhang J P, Su K H, Wang X, Liu Y, Sun X 2012 *Chin. Phys. B* **12** 060301  
 [15] Wang Y L, Su K H, Wang X, Liu Y, Ren H J, Xiao J 2012 *Chem. Phys. Lett.* **532** 90  
 [16] Frisch M J, Trucks G W, Schlegel H B, et al 2009 *Gaussian 09* Revision A.02, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009  
 [17] Truhlar D G, Isaacson A D, Garrett B C 1985 *Theory of Chemical Reaction Dynamics* (New York: New York Press) p65

# Investigation of C atom doped armchair ( $n, n$ ) single walled BN nanotubes with density functional theory\*

Wang Yan-Li<sup>†</sup> Su Ke-He Yan Hong-Xia Wang Xin

(Key Laboratory of Space Applied Physics and Chemistry, Ministry of Education of China, School of Natural and Applied Sciences, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

( Received 8 September 2013; revised manuscript received 1 November 2013 )

## Abstract

Structures and properties of single walled ( $n, n$ ) BN nanotubes doped with the C atom at different positions are studied by the DFT B3LYP/3-21G(d) theoretical method combined with the one-dimensional (1D) periodic boundary conditions. Their structure parameters, energies, stabilities, band structures and the energy gaps are explored. For the BN nanotubes doped with the C atom at different positions, the C atom concentrations  $x = 1/4n$  ( $n = 3-9$ ) are examined. It is found that the N site tubes are almost undistorted and more stable. The band gaps are within 1.054–2.411 eV for the C atom doped at the B sites, and those are narrower and within 0.252–1.207 eV for the N sites. All of the doped tubes are shown to be semiconducting and have direct gaps.

**Keywords:** doped, carbon nanotubes, periodic boundary condition, band structure

**PACS:** 61.46.Np, 81.07.De

**DOI:** [10.7498/aps.63.046101](https://doi.org/10.7498/aps.63.046101)

---

\* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50572089) and the Basic Research Foundation of Northwestern Polytechnical University, China (Grant No. JC201269).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: [wangyanli@nwpu.edu.cn](mailto:wangyanli@nwpu.edu.cn)